

- 이름 : 김태성
- 소속 :
- 연구분야 : 반도체 공정 가스

반도체 공정내 오염물 잔류가스 측정시스템 및 이를 이용한 오염물 잔류가스 측정방법 (10-2018-0082888)

상품 개요

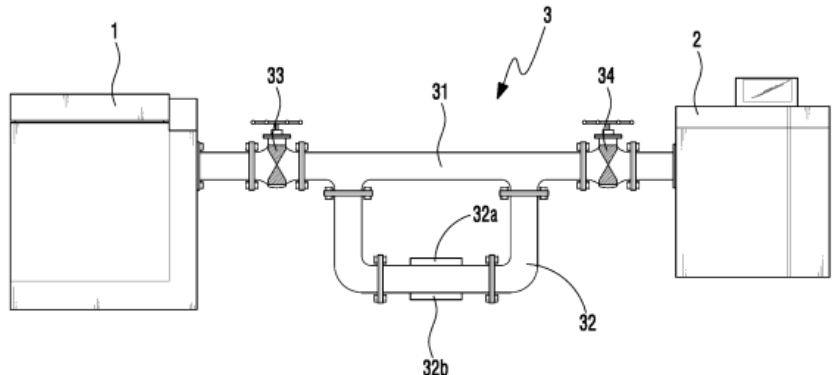
반도체 공정 내의 오염도를 보다 정확하게 측정하기 위한 반도체 공정 내 오염물 잔류가스 측정시스템 및 이를 이용한 오염물 잔류가스 측정방법

개발 현황

- 반도체 공정 내의 오염도를 보다 정확하게 측정할 수 있도록 하는 반도체 공정 내 오염물 잔류가스 측정시스템 및 이를 이용한 오염물 잔류가스 측정방법이 제공되며, 상기 측정시스템은 동일한 질량을 가지는 화합물을 분별하여 측정하는 것이 가능함

기술 상품 소개

- 반도체 제조공정의 진공용기;
- 상기 진공용기에서 발생하는 오염물 잔류가스를 측정하는 가스측정장치; 및
- 상기 진공용기와 상기 가스측정장치를 연결하는 본관부, 상기 본관부에 바이패스 형식으로 연결되며 냉각 및 가열이 가능한 측관부, 상기 진공용기와 상기 본관부사이를 개폐하는 제1밸브, 및 상기 본관부와 상기 가스측정장치 사이를 개폐하는 제2밸브로 구성되는 포집 파이프를 포함



기술완성도



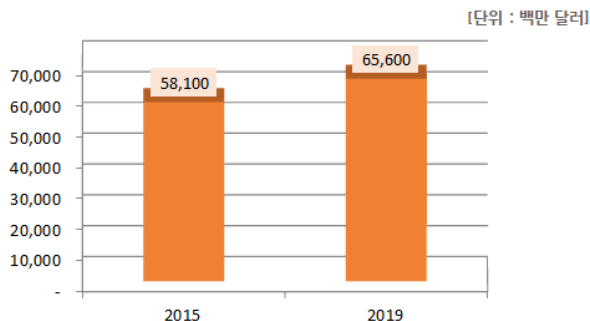
TRL3 :

시장적용분야

- 표면처리
- 플라즈마 공정
- 이온빔 식각

상품시장정보

- 플라즈마 표면처리 세계시장은 2010년 98조 원에서 2016년에는 110조 원에 달할 것으로 전망되며 연평균 2.4%의 성장률을 보일 것으로 예측
- 국내 시장은 연평균 10.5%의 높은 성장률에 힘입어 2015년 현재 6.74조 원에서 2016년에는 11조 원에 달할 것으로 전망



자료 : (사)한국전자회로산업협회 PCB BRIEFING(2015), 델타텍 재구성

[플라즈마 반도체웨이퍼 공정 시장 전망]

상품 추가정보

-출원인: 성균관대학교 산학협력단

-주 발명자: 김태성

-패밀리 특허

패밀리 특허 현황	없음
패밀리 국가	없음
판매금액	가격 협상

권리사항

No	특허명	특허번호
1	반도체 공정내 오염물 잔류가스 측정시스템 및 이를 이용한 오염물 잔류가스 측정방법	10-2018-0082888

문의처 

특허법인 현문 박지호 변리사

Tel : 02- 553-2208 | Email : jhp@hmip.kr